

BLADE 旗艦級落地式揚聲器



現在搭載 Metamaterial Absorption Technology 技術

自 1961 年以來，KEF 致力追求音質表現與極致的聆聽體驗，作為領航者在聲學工程領域不斷創新突破。2009 年，KEF 工程師在沒有任何前提與限制之下，天馬行空地打造出一款能展現 KEF 頂尖技術與創新能力的揚聲器，即革命性的 Concept Blade — 全球第一對同軸單點音源揚聲器。這個概念再經過不斷琢磨發展，終於在 2011 年成為音樂發燒友可以真正擁有的 HiFi 揚聲器。

Blade 是一種態度，是在不設前提下探索未知可能性的藝術，藉此突破 HiFi 的既有框架。因此，最新版的 Blade 採用了我們最新的聲學創新技術 - Metamaterial Absorption Technology¹ (MAT™)，量身打造出第 12 代 Uni-Q 同軸共點單體，更進行了一系列的改善項目。

Blade 系列有兩種產品：Blade One Meta 與 Blade Two Meta。兩者具備同樣的設計基因、使用同樣的高端技術、以及同樣搶眼的美學外型，差別是 Blade Two Meta 的尺寸略小。

單點音源技術

單點音源技術是 Blade 的核心。單點音源技術是以代表性 Uni-Q 同軸共點單體的延伸技術，也是 KEF 指標性聲音的基石。這項技術的宗旨是讓低頻、中頻、和高頻集中在同一個點發聲，實現聲學中單點音源的理想。

經完美校準的驅動單體涵蓋在揚聲器的全頻段上，並透過精準配置讓所有頻率的聲音都像是從單一音源發聲。Blade 內有四個低頻驅動單體緊密對稱地排列，圍繞在一個雙向 Uni-Q 驅動單體周圍，而內部中頻與高頻是共享同一個音源中心。

聲音成像明顯更加精細，讓清晰絕倫的音質在寬廣的區域均勻擴展。這就是 Blade 得以在全頻段呈現超乎想像的一致音色之主因，讓您感受最真實且身臨其境的聽覺饗宴。

結合 MAT™ 的革命性吸音技術

Metamaterial Absorption Technology (MAT) 技術是 KEF 聲學領域創新中的一项開創性的技術。其結構如一個高度複雜的迷宮，每條精密的通道能有效吸收特定頻率的雜音。當通道集合在一起，便化身為一個聲學黑洞，能消除高音單體後方所產生的雜音高達 99%，帶來更清澈、純淨的真實音效。

與 Acoustic Metamaterials Group 聯合研發的成果，利用 MAT 徹底顛覆揚聲器設計的既思維，並再次展現 KEF 鑽研新技術的熱忱，在追求終極聆聽體驗上，沒有一絲妥協。Metamaterials 是以既有材料經特殊研發結構製成，使其表現出天然物質中不存在，且是新的、符合使用需求的特質。

搭載 MAT™ 的第 12 代 Uni-Q，威力卓群

為 Blade 打造配有 MAT 技術的第 12 代 Uni-Q，是一組專為旗艦揚聲器量身打造同軸共點單體，帶來絲絲入扣的原音重現。這是淬鍊累積數十年的知識，並運用尖端模擬分析工具的成果。多項新研發的技術，都是 Blade 動人樂音幕後的功臣。

首先，坐落於最先進 Uni-Q 同軸共點單體中心位置的，是新型硬化鎂鋁合金球形高音單體，不論音量大小皆可穩定呈現甜美、清晰而優美的音色。KEF 工程師重新設計了高音單體之間的阻尼層，盡可能擴大後方緊鄰的空間，並加入新的 MAT 吸音層。共振腔形經最佳化處理，並悉心配置兩件多孔材料環，有效抑制共振與缺陷的形成，細節表現與清晰度大幅再提升。

全新極低失真中頻馬達設計，在馬達間隙置入一個銅環，大幅消弭電感和隨之音圈位移情形。進而降低中頻 THD 並減少熱壓縮，讓能源效率更高。

特色概要

- 單點音源技術徹底顛覆低頻、中頻、與高頻單體的配置，讓您聽到的聲音更加真實與身臨其境
- Metamaterial Absorption Technology 消弭 99% 的高頻失真，產生純淨自然的音效
- 搭載 MAT 的第 12 代 Uni-Q 同軸共點單體，締造驚人卓越的聲學準確性
- 兩對諧振抵消低音單體，提供清澈且延展極佳的重低音
- 新的分頻點設計改善信號路徑微調能力，帶來極致清晰度
- 音箱設計最佳化，打造最佳聲學表現
- 兩種型號：Blade One Meta、Blade Two Meta
- 提供八種顏色
- 可按需求客製化顏色



¹ Metamaterial Absorption Technology 是與 Acoustic Metamaterials Group 聯合研發的一項技術。

完全解耦的 Uni-Q 同軸共點單體，防止產生干擾震動降低聲音清晰度。採用新的彈性解耦底座設計，可降低震動並消除音染。由中頻與高頻馬達組產生的任何震動，因此不會傳遞到揚聲器音箱上。

新的驅動單體環繞設計，可在不造成衍射情況下延長偏移，藉此延展中頻音的頻率響應範圍。另外，圓頂、中頻音喇叭和環繞的輪廓均經過電腦運算的最佳化校正，讓聲音抵達箱體前的過渡階段完美平順。此外，完全解耦的 Uni-Q 同軸共點單體，可防止產生干擾震動降低聲音清晰度，並以獨特的瓣形波導管 (Tangerine Waveguide) 管理氣流，進而重現寬廣勻稱的自然音場，讓淨澈逼真的高頻音色充斥於整個空間。

這些創新研發成果的結晶，讓搭載 MAT 的第 12 代 Uni-Q 同軸共點單體得以締造前所未見、清澈純淨的生動原音。

俐落強勁的低音

Blade 四顆強大的通風低音單體，與搭載 MAT 技術之第 12 代 Uni-Q 完美結合，締造乾淨而穩定的低音效果。沿自 Blade 追求純淨度的初衷，將音圈與振膜進行解耦以使用低階數分頻器，獲得更淨透、更柔順的低音響應。為避免在大聲播放時擾動音箱，這些單體是以背對背方式配置，進而抵消可能影響輸出的諧振動能，且每對單體皆設有獨立音室，以減少阻尼材料的使用。

最新版本的 Blade 採用新的分頻點設計，改善信號路徑微調能力，帶來極致清晰度。此外，還配有兩對發燒級 WBT 端子，可支援雙接線 (bi-wiring) 或雙擴大機 (bi-amping) 的無損傳輸。

精湛表現始於設計

Blade 具雕塑感的外觀，是源自聲學結構設計。由上到下，從前到後優雅地逐漸變細窄，透過正面微拱弧線輕輕流淌出清晰樂音。隔音箱體由超高密度聚氨酯複合材料製成，交疊起伏的曲線經過精心設計，可消除會讓聲音模糊的駐波。

而承載這些精密技術的箱體外表，共有八款繽紛色彩可供選擇，由五種箱體顏色搭配六種錐形單體顏色混合而成。您可以選擇從三種拋光顏色的箱體與相應的 Uni-Q 驅動單體顏色搭配：極地白／香檳色、超跑紅／灰色、鋼琴黑／銅色；或從兩個啞光顏色箱體與相應的 Uni-Q® 驅動單體顏色搭配：冰原藍／藍色、冰原藍／青銅色、炭灰色／紅色、炭灰色／青銅色。如果這些配色還不夠，客戶還可以提供自己偏好的 Pantone 色 來訂製專屬的揚聲器箱體配色，打造個人化的獨特 Blade。

Blade 以追求最精準真實聲音而不斷創新的理念所打造，並將這個開創性思維發揮淋漓盡致的成果，締造最極致的聆聽體驗。



極地白／香檳色

超跑紅／灰色

鋼琴黑／銅色

鋼琴黑／灰色

冰原藍／藍色

冰原藍／青銅色

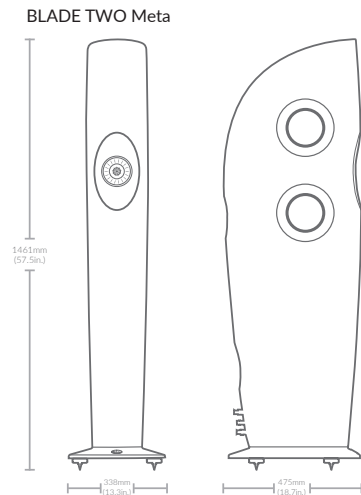
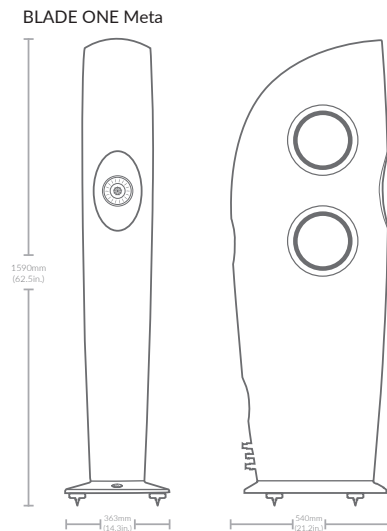
炭灰色／紅色

炭灰色／青銅色



規格

型號	BLADE ONE Meta	BLADE TWO Meta
設計	三音路低音反射式 單點音源配置	三音路低音反射式 單點音源配置
驅動單體	Uni-Q 同軸共點單體： 高音單體：25毫米 (1 吋) MAT 技術鋁製球型單體 中音單體：125毫米 (5 吋) 鎂鋁合金錐體 低音單體： 低音單體：4 x 225 毫米 (9 吋) 鎂鋁合金錐體 諧振抵消	Uni-Q 同軸共點單體： 高音單體：25毫米 (1 吋) MAT 技術鋁製球型單體 中音單體：125毫米 (5 吋) 鎂鋁合金錐體 低音單體： 低音單體：4 x 225 毫米 (9 吋) 鎂鋁合金錐體 諧振抵消
頻率響應範圍開放音場 (-6dB)	27 Hz - 45k Hz	30 Hz - 45k Hz
頻率範圍典型室內低音響應 (-6dB)	20Hz	25Hz
頻率響應 (±3dB)	35 Hz - 35k Hz	33 Hz - 35k Hz
分頻點	350 Hz, 2k Hz	450 Hz, 2.2k Hz
擴大機需求	50 - 400W	50 - 400W
靈敏度 (2.83V/1m)	88 dB	86 dB
二次諧波失真與 三次諧波 (90dB, 1m)	<0.5% 40 Hz - 100k Hz <0.2% 200 Hz - 2k Hz <0.1% 2k Hz - 20k Hz	<0.5% 40 Hz - 100k Hz <0.2% 200 Hz - 2k Hz <0.1% 2k Hz - 20k Hz
最大輸出 (SPL) (1m 處的峰值音壓， 使用粉紅噪訊)	117dB	116dB
阻抗	4 Ω (最小 2.8 Ω)	4 Ω (最小 3.2 Ω)
重量	57.2 公斤 (126 磅)	35.5 公斤 (77.8 磅)
尺寸 - 含底座 (高 x 寬 x 深)	1590 x 363 x 540 毫米 (62.5 x 14.3 x 21.2 吋)	1461 x 338 x 475 毫米 (57.5 x 13.3 x 18.7 吋)
標準顏色	鋼琴黑／銅色、鋼琴黑／灰色、冰原藍／藍色、冰原藍／青銅色、炭灰色／紅色、炭灰色／青銅色、超跑紅／灰色、 以及極地白／香檳色	



查看更多關於 KEF 及產品資訊，請參考 [KEF.com](https://www.kef.com)。
KEF 保留根據持續研究與開發修改或更改規格的權利。E&OE.